

# Hitz日立造船株式会社

## 2009年度第2四半期決算説明会

1. 2009年度第2四半期連結決算概況
2. 2009年度業績予想
3. 中期経営計画「Hitz Innovation II」の進捗状況

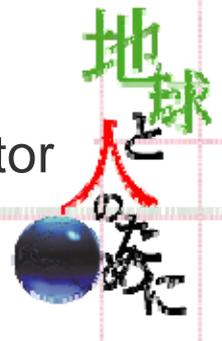
Technology &  
Business Innovator



- 1. 営業利益、経常利益の拡大  
（過去最高益を更新）**
- 2. 自己資本比率の増加**

# 1. 2009年度第2四半期連結決算概況

Technology &  
Business Innovator



# 損益概要

(億円)	2008年度 2Q累計	2009年度 2Q累計	比較
受注高	1,564	1,462	▲102
売上高	1,217	(1,300) 1,233	16
営業利益 (営業利益率)	41 (3.4%)	(35) (2.7%) 55 (4.5%)	14 (1.1%)
営業外損益	▲5	16	21
経常利益 (経常利益率)	36 (3%)	(25) (1.9%) 71 (5.8%)	35 (2.8%)
特別損益	▲44	-	44
税引前四半期純利益	▲7	71	78
四半期純利益 (四半期純利益率)	▲20 (▲1.6%)	(20) (1.5%) 70 (5.7%)	90 (7.3%)

(注)2009年度第2四半期累計期間の括弧内の数字は、2009年5月に公表した見通し。

# セグメント別営業損益状況

(億円)

		環境・ プラント	機械・ プロセス 機器	精密機械	鉄構・ 建機	その他	計
2009年度 2Q累計	売上高	435	466	59	120	153	1,233
	営業利益	▲7	58	▲1	3	2	55
2008年度 2Q累計	売上高	442	390	82	116	187	1,217
	営業利益	1	40	3	▲9	6	41
比較	売上高	▲7	76	▲23	4	▲34	16
	営業利益	▲8	18	▲4	12	▲4	14

# 営業損益の増減内訳

2008 年度 2Q 累計 営業損益		41
増 減 内 訳	1. 会計基準(工事進行基準)変更による影響	3
	2. コスト・ダウン他	11
		14
2009 年度 2Q 累計 営業損益		55

# 営業外損益の内訳

(億円)	2008年度 2Q累計	2009年度 2Q累計	比較
金利負担額 (受取利息－支払利息)	▲8	▲7	1
受取配当金	1	1	0
持分法による投資利益	1	17	16
その他営業外損益	1	5	4
計	▲5	16	21

# 特別損益内訳

		(億円)	2008年度 2Q累計	2009年度 2Q累計	比較
特別利益	固定資産売却益		5	—	▲5
特別損失	訴訟損失引当金繰入額		▲49	—	49
特別損益合計			▲44	—	44

# キャッシュフロー・有利子負債

		(億円)	2008年度 2Q累計	2009年度 2Q累計	比較
キャッシュフロー	営業活動によるキャッシュフロー		24	▲22	▲46
	投資活動によるキャッシュフロー		▲66	▲60	6
	財務活動によるキャッシュフロー		▲149	▲27	122
	その他の増減		▲1	—	1
	キャッシュフロー増減額合計		▲192	▲109	83
	現金・現金同等物の期首残高		542	500	▲42
	現金・現金同等物の期末残高		350	391	41

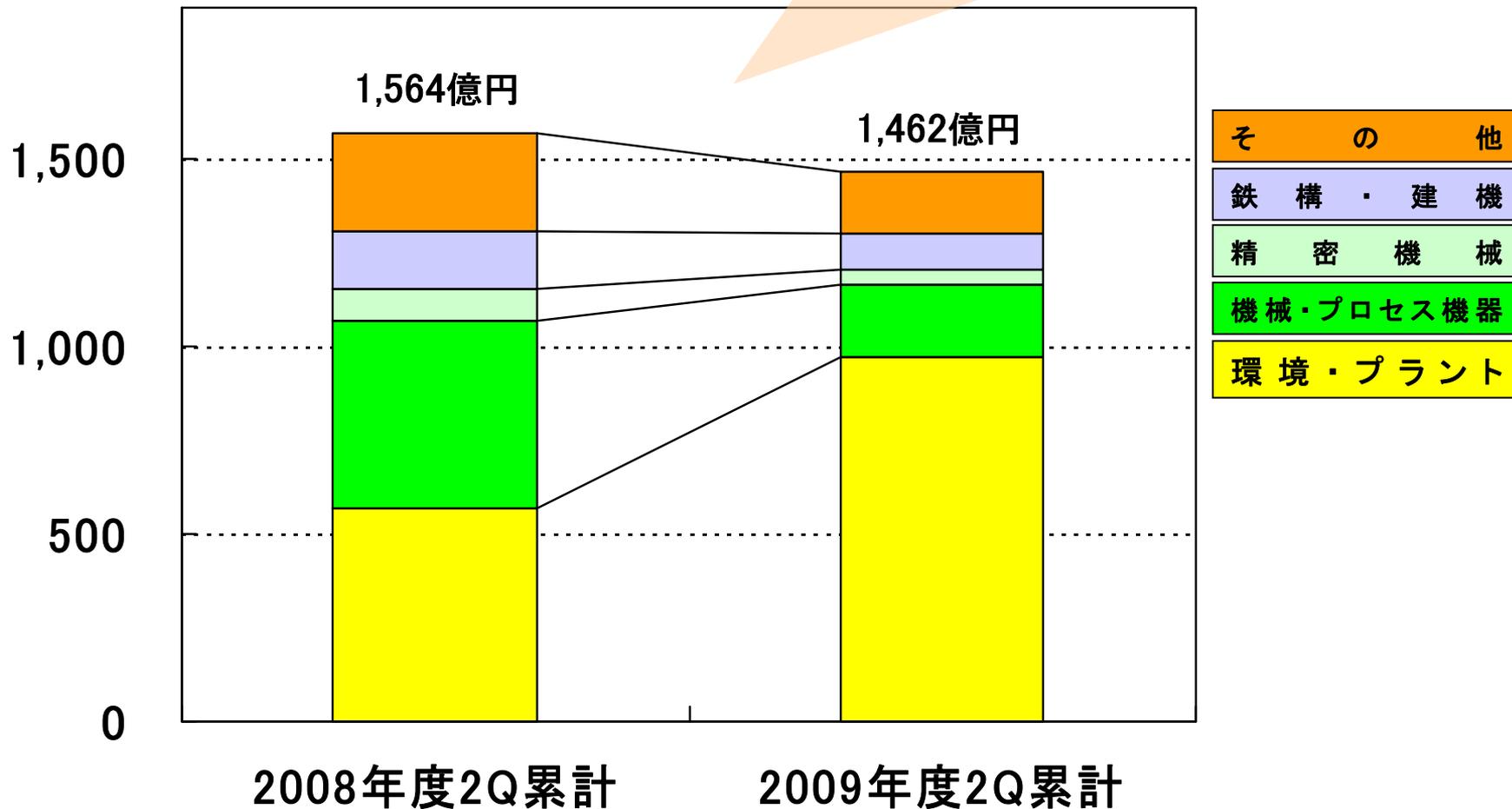
		(億円)	2009年 3月末	2009年 9月末	比較
有利子負債	借入金		(注) 696	(注) 680	▲16
	社債		340	332	▲8
	合計		1,036	1,012	▲24

(注)リース債務を含む。

# セグメント別受注状況

(億円)

▲102億円(▲6.5%)減



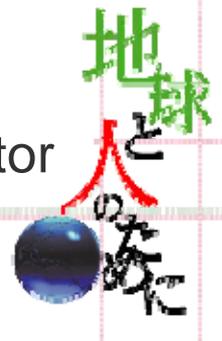
# セグメント別受注状況

(億円)

	2008年度 2Q累計	2009年度 2Q累計	比較	
環境・プラント	569	970	(70.5%)	▲401
機械・プロセス機器	500	191	(▲61.8%)	▲309
精密機械	84	40	(▲52.3%)	▲44
鉄構・建機	149	97	(▲34.9%)	▲52
その他	262	164	(▲37.4%)	▲98
受注高合計	1,564	1,462	(▲6.5%)	▲102

## 2. 2009年度業績予想

Technology &  
Business Innovator



# 2009年度業績予想

(億円)	2008年度 実績	2009年度 5月時見通し	2009年度 今回見通し
受注高	2,531	3,300	3,300
売上高	2,986	3,000	2,900
営業利益 (営業利益率)	116 (3.9%)	100 (3.3%)	120 (4.1%)
経常利益 (経常利益率)	89 (3%)	70 (2.3%)	130 (4.5%)
特別損益	▲43	0	0
その他	▲32	▲20	▲30
当期純利益 (当期純利益率)	14 (0.5%)	50 (1.7%)	100 (3.4%)
ROIC	6.8%	5.7%	6.8%

\* ROIC(投下資本利益率) = 営業利益 ÷ 投下資本

投下資本 = 自己資本 + 有利子負債 + 少数株主持分 - (短期有価証券 + 投資有価証券)

# 2009年度セグメント別受注見通し

(億円)

	2008年度 A	2009年度 見通し (5月時) B	2009年度 見通し (今回) C	比較 C-A	比較 C-B
環境・プラント	1,005	1,700	1,600	595	▲ 100
機械・プロセス機器	653	850	850	197	0
精密機械	133	150	250	117	100
鉄構・建機	303	250	250	▲ 53	0
その他	437	350	350	▲ 87	0
受注高合計	2,531	3,300	3,300	769	0

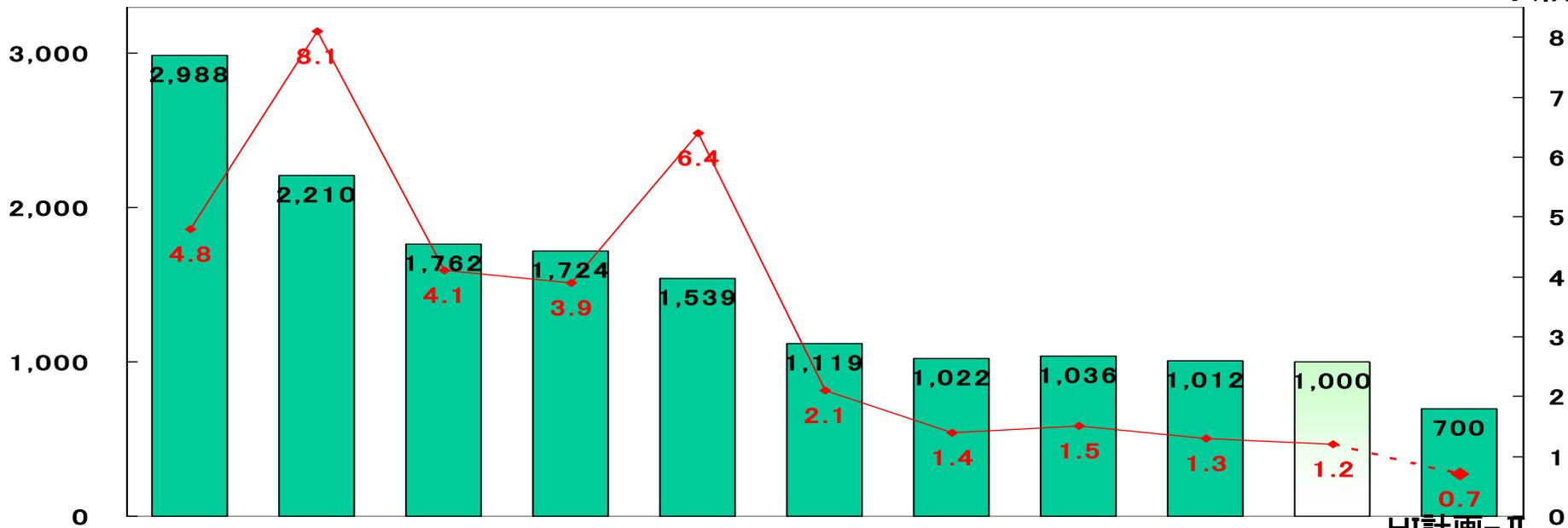
# 2009年度セグメント別営業損益見通し

(億円)		環境・プラント	機械・プロセス機器	精密機械	鉄構・建機	その他	計
		2009年度見通し (今回) A	売上高	1,150	905	170	335
	営業利益	30	84	▲ 6	2	10	120
2009年度見通し (5月時点) B	売上高	1,200	950	180	320	350	3,000
	営業利益	30	60	0	0	10	100
2008年度 C	売上高	1,208	887	205	301	385	2,986
	営業利益	22	84	5	▲ 13	18	116
比較 A-B	売上高	▲ 50	▲ 45	▲ 10	15	▲ 10	▲ 100
	営業利益	0	24	▲ 6	2	0	20
比較 A-C	売上高	▲ 58	18	▲ 35	34	▲ 45	▲ 86
	営業利益	8	0	▲ 11	15	▲ 8	4

# 有利子負債残高の見通し

(億円)

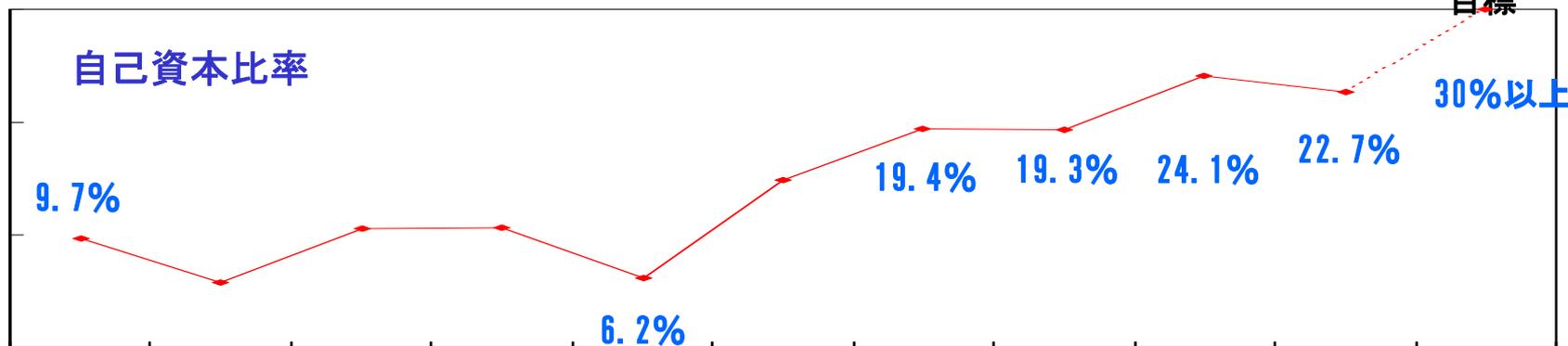
D/Eレシオ(倍)



(注)2009年3月末以降はリース債務を含む。

HI計画-II  
目標

## 自己資本比率



2002年  
3月末

2003年  
3月末

2004年  
3月末

2005年  
3月末

2006年  
3月末

2007年  
3月末

2008年  
3月末

2009年  
3月末

2009年  
9月末

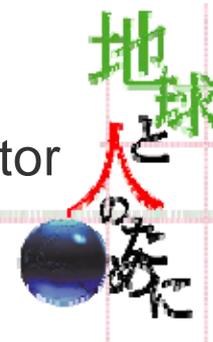
2010年  
3月末  
見通し

2011年  
3月末  
計画

### 3. 中期経営計画「Hitz Innovation II」 (2008～2010年度)の進捗状況

---

Technology &  
Business Innovator

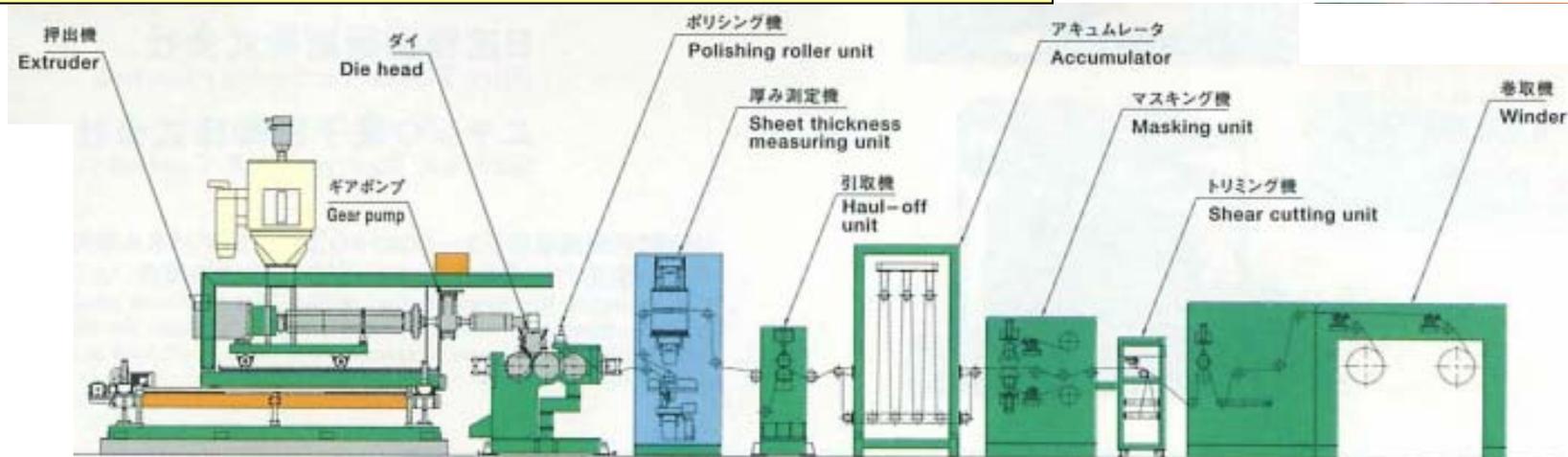


# 「Hitz Innovation II」計画の重点施策

重点施策	進捗状況
1. ポートフォリオ経営の推進	<ul style="list-style-type: none"> <li>・注力事業の明確化、経営資源投入               <ul style="list-style-type: none"> <li>→ 船用エンジンの中国製造合弁会社発足</li> <li>→ <b>太陽電池フィルム一貫製造システムの確立</b></li> </ul> </li> </ul>
2. 新製品・新事業開発と設備投資拡大	<ul style="list-style-type: none"> <li>・注力事業への積極的な設備投資               <ul style="list-style-type: none"> <li>→ 堺工場内の産業機械専用新工場の稼動</li> <li>→ 高効率蒸発法海水淡水化プラント/実証機の建設</li> <li>→ 有明工場での大型重量物積出設備の設置</li> </ul> </li> <li>・新分野の開拓               <ul style="list-style-type: none"> <li>→ シールド掘進機の中国での協業</li> <li>→ <b>米国脱硝触媒工場の稼動</b></li> </ul> </li> </ul>
3. 人材育成策の強化と人材確保・活用	<ul style="list-style-type: none"> <li>・女性などが働きやすい職場づくり・環境づくり               <ul style="list-style-type: none"> <li>→ 女性戦力拡大グループの設置</li> </ul> </li> <li>・長期的な人材の育成策の推進               <ul style="list-style-type: none"> <li>→ 研修・教育プログラムの新設、人事制度の見直し</li> </ul> </li> </ul>
4. ガバナンス体制の継続的強化	<ul style="list-style-type: none"> <li>・最適な経営形態、組織体制(事業持株会社制、純粋持株会社制またはHitz本体の強化・拡大)の検討、構築               <ul style="list-style-type: none"> <li>→ 関係会社10社のHitz本体への統合</li> </ul> </li> </ul>
5. 価値観の共有化と企業カルチャーの変革	<ul style="list-style-type: none"> <li>・企業理念などの価値観の共有と変革し続ける企業風土               <ul style="list-style-type: none"> <li>→ 「Hitz Value」の共有化</li> <li>→ 外部コンサルタント起用による風土改革運動の継続</li> </ul> </li> </ul>

# 太陽電池フィルム製造装置(機能性フィルム装置)

- ◆ 対象主製品 : 耐熱性フレキシブル基板フィルム
- ◆ 製品厚み : 50~400  $\mu\text{m}$  (最小20~30  $\mu\text{m}$ )
- ◆ 製品幅 : 500mm
- ◆ 押出量 : 10~30kg/h

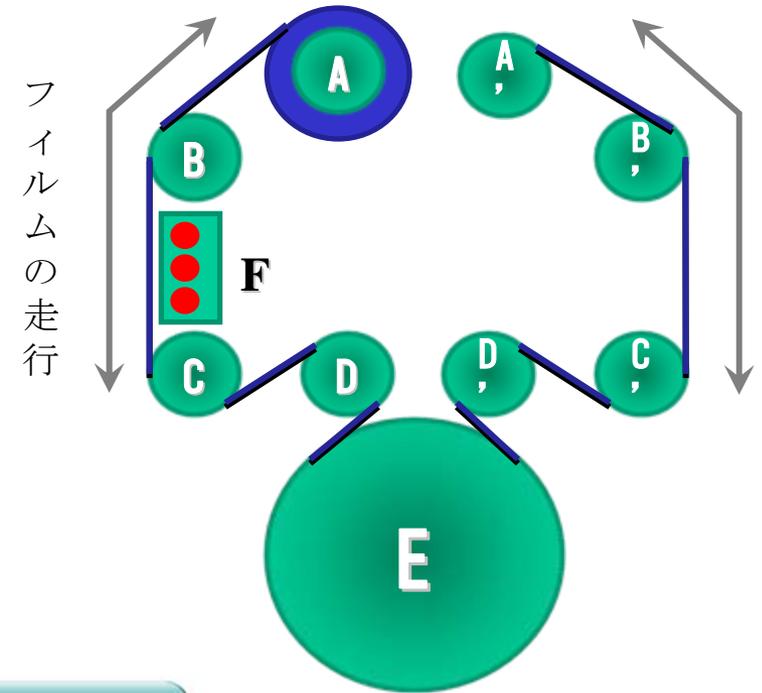


ポリシング機

## キーワード

- ① 低残留歪
- ② 両表面平滑性、鏡面性
- ③ 高厚み精度
- ④ 高温熔融・高温成形
- ⑤ 省エネ

# 太陽電池フィルム製造装置(ロールtoロール成膜装置)



## 用途、分野 Usage and field

- ① 有機EL  
Organic Electroluminescence
- ② 太陽電池  
Solar Cell
- ③ 半導体  
Semiconductor
- ④ 電子ペーパー  
Electronic Paper
- ⑤ フレキシブル回路基板  
Flexible Circuit Board
- ⑥ 電磁波シールド  
Electromagnetic Wave Shield

## 成膜方式 Deposition method

- ① マグネトロンスパッタリング  
Magnetron Sputtering
- ② 対向式スパッタリング  
Faced Target Sputtering
- ③ 蒸着  
Evaporation
- ④ EB-GUN蒸着  
EB-GUN Evaporation

## 膜種 Layer

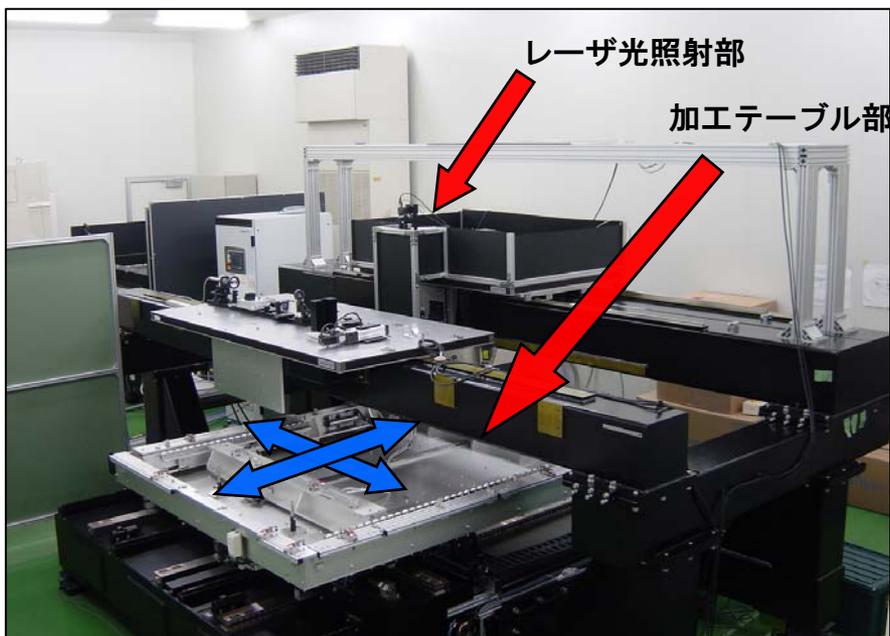
- ① バリア膜  
Barrier Layer
- ② 透明導伝膜  
Transparent conductive Layer
- ③ 金属膜  
Metal Layer

成膜用: スパッタカソード

- A,A' : 巻き出し、巻き取りロール  
 B,B' : フリーロール(ガイドロール)  
 C,C' : フリーロール(ガイドロール)  
 D,D' : 張力検出ロール  
 E : キャンロール(冷却用)  
 F : 脱ガス用ヒーター加熱ユニット

# 太陽電池フィルム製造装置(レーザ加工装置)

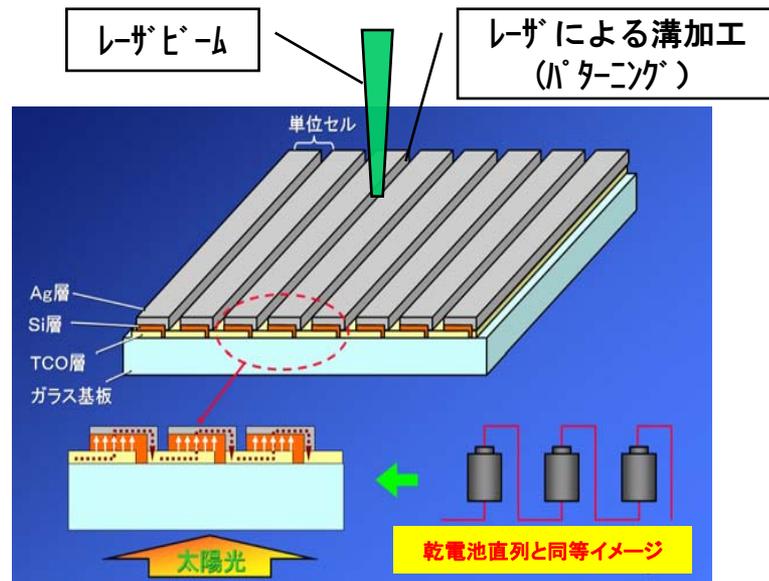
## 当社レーザ加工デモ実証機



### デモ実証機 主仕様

テーブルサイズ	最大1400×1400mm
テーブル速度	最大1000mm/s
テーブル精度	<±5μm

## 薄膜系太陽電池構造とレーザ加工



## 太陽電池製品種類例



薄膜系太陽電池

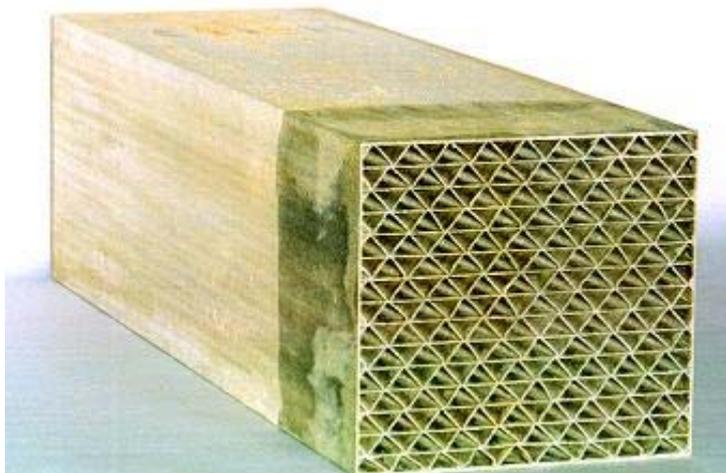


フレキシブル太陽電池

# 米国脱硝触媒工場稼動へ

H&N Catalyst Manufacturing LLC（日立造船とニチアス(株)の合併会社）  
2010年春 工場稼動へ

【資本金】	US\$ 8,000,000（約 8億円）
【出資比率】	日立造船： 50% ニチアス： 50%
【場 所】	米国 アラバマ州 スコッツボロ市
【稼動開始】	2010年3月予定
【生産規模】	脱硝触媒製造能力： 4,000m <sup>3</sup> /年
【目 的】	米国並びに中国等諸外国のNOX排出規制による石炭ボイラー向け脱硝触媒の需要急増に対応する為



脱硝触媒



米国脱硝工場 H&N

# 計 数 計 画

	2007年度 実績	2008年度 実績	2009年度 見通し	(億円) 2010年度 HI-Ⅱ 計画値
受 注 高	3,377	2,531	3,300	3,600
売 上 高	2,955	2,986	2,900	3,400
営 業 利 益 ( 営 業 利 益 率 )	108 (3.7%)	116 (3.9%)	120 (4.1%)	170 (5%)
経 常 利 益 ( 経 常 利 益 率 )	72 (2.4%)	89 (3%)	130 (4.5%)	160 (4.7%)
当 期 純 利 益	156	14	100	90
R O I C (*1)	7%	7%	7%	12%以上
有 利 子 負 債 残 高	1,022	1,035	1,000	700以下
自 己 資 本 比 率	19%	19%	23%	30%以上 (*2)

(\*1) ROIC(投下資本利益率) = 営業利益 ÷ 投下資本

投下資本 = 自己資本 + 有利子負債 + 少数株主持分 - (短期有価証券 + 投資有価証券)

(\*2) 自己資本比率30%以上は、目標値。

The logo consists of the word "Hitachi Zosen" in a bold, blue, sans-serif font. The letter "i" in "Hitachi" has a yellow-to-white gradient bar above it.

# Hitachi Zosen

Hitachi Zosen

Technology &  
Business Innovator

